

X!Focus Software

Für dynamische Fokuseinstellung

Zielsetzung

Die X!Focus-Software garantiert optimale Belichtungsergebnisse mit einem dynamisch geregelten Fokus auch bei unebenen Oberflächen.

Hauptfunktion

Die Distanz der Optik zur Oberfläche der Druckform wird dynamisch gemessen, die Optik entsprechend justiert und der Laserstrahl dadurch kontinuierlich fokussiert.

Ohne X!Focus wird die ganze Druckform mit derselben Fokuseinstellung bebildert. Ist also die Druckform, z.B. ein Sieb, verbogen, ergibt dies an verschiedenen Stellen ein ungenügendes Belichtungsergebnis, da der Laserstrahl nicht fokussiert ist.

Ohne X!Focus mit einer unebenen Oberfläche



Gelb: Oberfläche Druckmedium. **Schwarz:** Fokus des Laserstrahls

Mit X!Focus auf einer unebenen Oberfläche



Gelb: Oberfläche Druckmedium. **Schwarz:** Fokus des Laserstrahls

Um schlechte Belichtungen zu vermeiden, misst ein Sensor laufend die Distanz zum Druckform, wobei ein Motor den Abstand zwischen Optik und Druckform kontinuierlich nachkorrigiert. Die maximale Korrektur beträgt 0.8 mm/s.

Vorteile

- Unebene Oberflächen können überall mit derselben Qualität bebildert werden
- Hohe Produktionssicherheit ist gewährleistet
- Laserstrahl hat immer den optimalen Fokus auf der Druckform

Lüscher Technologies AG

Industriestrasse 17
4665 Oftringen
Schweiz

Telefon +41 62 767 76 76
contact@luescher.com
www.luescher.com

lüscher
Technologies